

【支援利用負担金】

1. 機器利用料（ARIM 事業・データ提供の場合、消費税込み）

(円/15分)					
装置番号	ARIM 装置番号	装置名	大学/公的 研究機関	民間企業等	備考
F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置（NanoFab）	5,000	7,500	
I21	OS-114	RFスパッタ成膜装置（金属成膜用）	2,075	3,115	Au、Ptは別途請求
I22	OS-115	RFスパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	1,925	2,890	Au、Ptは別途請求
I23	OS-110	リアクティブイオンエッチング装置（10NR）	2,075	3,115	
I24	OS-109	深掘りエッチング装置（400iPB）	3,125	4,690	
I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィー装置（125keV EBL）	3,750	5,625	
N01	OS-102	SEM付集束イオンビーム装置（Nvision）	2,500	3,750	
N02	OS-111	リアクティブイオンエッチング装置（10NOU）	1,250	1,875	
N03	OS-113	多元DC/RFスパッタ装置	2,500	3,750	Au、Ptは別途請求
N05	OS-117	EB蒸着装置	1,250	1,875	Au、Ptは別途請求
N07	OS-126	接触式膜厚測定器	1,200	1,800	
N08	OS-107	マスクアライナー	1,175	1,765	
N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィー装置（50keV EBL）	3,750	5,625	
N10	OS-104	自動搬送電子ビーム描画装置（150kV BODEN）	4,175	6,265	
N11	OS-129	マスクレス露光装置（MLA150）	1,625	2,440	
N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	900	1,350	
N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡	750	1,125	
N33	OS-128	物理特性測定装置（PPMS）	5,000	7,500	
S01	OS-108	ナノインプリント装置	2,000	3,000	
S32	OS-120	薄膜X線回折装置	1,250	1,875	
S35	OS-123	ナノ粒子解析装置（ゼータサイザー）	1,000	1,500	

付帯装置の利用料金（付帯装置単独での利用は出来ません）

(円/15分)			
装置番号	装置名	大学/公的研究機関	民間企業等
N71	タングステンコーター	140	210
N72	プラズマクリーナー	140	210
N73	スピンコーター	140	210
N74	UVオゾンクリーナー	140	210
N75	ワイヤーボンダー	140	210

・利用時間とは装置予約時間（使用の有無は問わない）を指し、予約時間前後に延長利用した場合はその時間も含まれます（ただし予約無しで利用できる装置(N71～N75)は、実使用時間を利用時間とする）

・上記は 15 分あたりの単価であり、これに利用時間を乗じた額を機器利用料とします

・装置予約の取り消しは予約日開始時間の 24 時間前に締め切り、それ以降の取り消しについては当該予約の 100%に相当する額を徴収します

・一予約当たりで 15 分未満の端数は切り上げ、15 分として算出します

2. 課題毎の装置利用料の上限額（消費税込み）

【ARIM 事業・データ提供の場合】

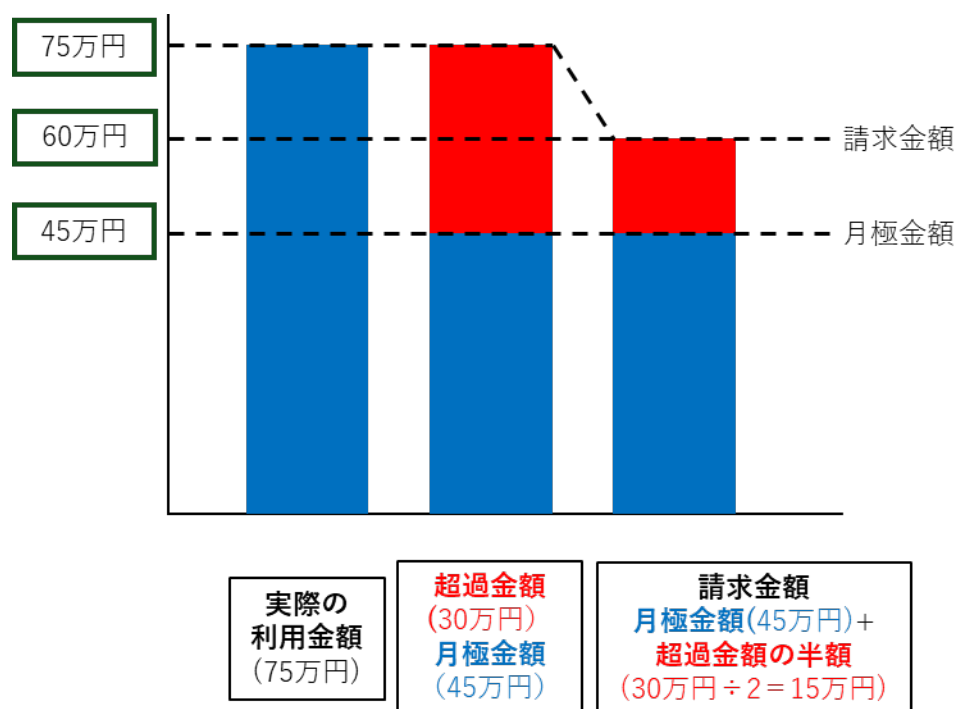
(千円)

	大学・公的研究機関	民間企業等
月極料金	450	675
年極料金	5,400	8,100

・今年度より、月額上限を超えた料金については、超過額の半額を超過料金として課金します

例えば、ある月の利用料金が75万円となった場合（大学・公的研究機関）、超過額は
 $75\text{万円} - 45\text{万円} = 30\text{万円}$ となり、超過分の半額（15万円）が超過料金となり
 $45\text{万円} + 15\text{万円} = 60\text{万円}$ をその月の利用料金として請求することになります

【例題：大学・公的研究機関の場合】



3. 技術支援料

(円/15分)

	ARIM事業		自主事業	
	大学・公的研究機関	民間企業等	大学・公的研究機関	民間企業等
技術代行	1,000	1,500	無し	無し
オペレーショントレーニング	250	375	750	1,125

- ・オペレーショントレーニングについては標準サンプルのみとします
- ・一予約当たりで15分未満の端数は切り上げ、15分として算出します

4. クリーンルーム入室料（消費税込み、ARIM 事業や自主事業によらず同額）

課金対象となる実験室	円/日・人	備考
I-215	500	上限 5,000 円/月
N-415	500	上限 5,000 円/月

5. 消耗品（成膜用材料、レジスト、シリコンウエハ、他）の取扱い

(1)成膜用材料；Au と Pt については現行通り有償とし、それ以外は原則ユーザー持参とします

課金対象となる機器		Au	Pt
OS-114	RFスパッタ成膜装置（金属成膜用）	400円/分	100円/分
OS-115	RFスパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	400円/分	100円/分
OS-113	多元DC/RFスパッタ装置	1500円/分	1000円/分
OS-117	EB蒸着装置	1650円/0.1g	650円/0.1g

- ・Au、Pt は別途請求となり、時間（分）単位、もしくは 0.1g 単位で請求します
料金は予約単位毎に計算し、請求します

(2)レジスト、シリコンウエハ；ユーザーが持参ください

(3)DMF とエスペイサーは、今年度より大阪大学 ARIM 拠点での取り扱いが無くなりましたのでご承知おきください

6. 機器利用料（ARIM 事業・データ非提供の場合、消費税込み

(円/15分)					
装置番号	ARIM 装置番号	装置名	大学/公的 研究機関	民間企業等	備考
F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置（NanoFab）	6,000	9,000	
I21	OS-114	RFスパッタ成膜装置（金属成膜用）	2,500	3,750	Au、Ptは別途請求
I22	OS-115	RFスパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	2,300	3,450	Au、Ptは別途請求
I23	OS-110	リアクティブイオンエッチング装置（10NR）	2,500	3,750	
I24	OS-109	深掘りエッチング装置（400iPB）	3,750	5,625	
I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィー装置（125keV EBL）	4,500	6,750	
N01	OS-102	SEM付集束イオンビーム装置（Nvision）	3,000	4,500	
N02	OS-111	リアクティブイオンエッチング装置（10NOU）	1,500	2,250	
N03	OS-113	多元DC/RFスパッタ装置	3,000	4,500	Au、Ptは別途請求
N05	OS-117	EB蒸着装置	1,500	2,250	Au、Ptは別途請求
N07	OS-126	接触式膜厚測定器	1,440	2,160	
N08	OS-107	マスクアライナー	1,400	2,100	
N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィー装置（50keV EBL）	4,500	6,750	
N10	OS-104	自動搬送電子ビーム描画装置（150kV BODEN）	5,000	7,500	
N11	OS-129	マスクレス露光装置（MLA150）	1,950	2,925	
N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	1,080	1,620	
N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡	900	1,350	
N33	OS-128	物理特性測定装置（PPMS）	6,000	9,000	
S01	OS-108	ナノインプリント装置	2,400	3,600	
S32	OS-120	薄膜X線回折装置	1,500	2,250	
S35	OS-123	ナノ粒子解析装置（ゼーターサイザー）	1,200	1,800	

付帯装置の利用料金

(円/15分)			
装置番号	装置名	大学/公的研究機関	民間企業等
N71	タングステンコーター	140	210
N72	プラズマクリーナー	140	210
N73	スピンコーター	140	210
N74	UVオゾンクリーナー	140	210
N75	ワイヤーボンダー	140	210

付帯装置単独での利用は出来ません

(千円)		
	大学・公的研究機関	民間企業等
月極料金	540	810
年極料金	6,480	9,720

今年度より、月額上限を超えた料金については、超過額の半額を超過料金として課金します
 なお、詳細は2. 1 課題毎の装置利用料の上限額（消費税込み）を参照ください

7. 機器利用料（自主事業、消費税込み）

(円/15分)					
装置番号	ARIM 装置番号	装置名	大学/公的 研究機関	民間企業等	備考
F11	OS-101	高精細集束イオンビーム装置（NanoFab）	18,000	27,000	
I21	OS-114	RFスパッタ成膜装置（金属成膜用）	7,500	11,250	Au、Ptは別途請求
I22	OS-115	RFスパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）	6,900	10,350	Au、Ptは別途請求
I23	OS-110	リアクティブイオンエッチング装置（10NR）	7,500	11,250	
I24	OS-109	深掘りエッチング装置（400iPB）	11,250	16,875	
I25	OS-103	超高精細電子ビームリソグラフィー装置（125keV EBL）	13,500	20,250	
N01	OS-102	SEM付集束イオンビーム装置（Nvision）	9,000	13,500	
N02	OS-111	リアクティブイオンエッチング装置（10NOU）	4,500	6,750	
N03	OS-113	多元DC/RFスパッタ装置	9,000	13,500	Au、Ptは別途請求
N05	OS-117	EB蒸着装置	4,500	6,750	Au、Ptは別途請求
N07	OS-126	接触式膜厚測定器	4,320	6,480	
N08	OS-107	マスクアライナー	3,525	5,290	
N09	OS-105	高速大面積電子ビームリソグラフィー装置（50keV EBL）	13,500	20,250	
N10	OS-104	自動搬送電子ビーム描画装置（150kV BODEN）	15,000	22,500	
N11	OS-129	マスクレス露光装置（MLA150）	5,850	8,775	
N31	OS-127	レーザーラマン顕微鏡	3,240	4,860	
N32	OS-125	走査型プローブ顕微鏡	2,700	4,050	
N33	OS-128	物理特性測定装置（PPMS）	18,000	27,000	
S01	OS-108	ナノインプリント装置	7,200	10,800	
S32	OS-120	薄膜X線回折装置	4,500	6,750	
S35	OS-123	ナノ粒子解析装置（ゼーターサイザー）	3,600	5,400	

付帯装置の利用料金

(円/15分)			
装置番号	装置名	大学/公的研究機関	民間企業等
N71	タングステンコーター	415	620
N72	プラズマクリーナー	415	620
N73	スピンコーター	415	620
N74	UVオゾンクリーナー	415	620
N75	ワイヤーボンダー	415	620

付帯装置単独での利用は出来ません

(千円)		
	大学・公的研究機関	民間企業等
月極料金	1,620	2,430
年極料金	19,440	29,160

今年度より、月額上限を超えた料金については、超過額の半額を超過料金として課金します
 なお、詳細は2. 1 課題毎の装置利用料の上限額（消費税込み）を参照ください